

## IV. 下水排除基準・特定施設等

### 1. 水質汚濁防止法による排水規制

水質汚濁防止法では、人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある物質等、一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設を「特定施設」として指定し、この施設を有する工場・事業場から公共用水域に排出される水について全国一律の排水基準を定め、規制を行っている。しかし、一律排水基準では水質汚濁防止上、不十分と考えられる水域については、条例でより厳しい排水基準を設定している場合もある。

この法律は、公共用水域における水質保全の法規制であるが、下水道との関連においていえば、以下のことが重要である。

(1) 終末処理場が設置されている公共下水道及び流域下水道（その流域下水道に接続する公共下水道を含む）は、公共用水域から除外されていること。ただし、下水道処理区域内にある工場・事業場等で、公共下水道を使用する場合は、下水道法によりその排水に対して規制を受けることになる。

(2) 下水道終末処理施設は、特定施設とされていること。

### 2. 下水道法による放流水の水質基準及び下水排除基準

下水道が公共用水域の水質保全に資するためには、下水道から河川その他の公共用水域へ放流される水の水質管理を適正に行う必要がある。このため、下水道法では、公共下水道及び流域下水道から、河川その他公共用水域に放流される水の水質の基準を定めている。

また、カドミウム、シアン等の物質を含む下水はそもそも終末処理場で処理することが困難であり、BOD、SS等の項目についても、汚濁の程度の著しい下水は終末処理場で処理することは困難である。したがって、下水道からの放流水の水質を基準に適合させるためには、このような下水は工場等個々の発生源で事前に処理した上で、下水道に排除させることが必要である。このほか管渠を腐食するおそれのある下水等、下水道の施設の機能を妨げたり、施設を損傷したりするおそれのある下水についても、個々の発生源での事前処理を徹底することが必要である。このため、下水道法及び市町村の下水道条例により、下水道へ排除するための水質基準が定められており、この基準に満たない下水（水洗便所から排除される汚水は除く）を排除するものには除外施設の設置等が義務付けられている。

### 3. 特定施設

特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で、次の2種類が下水道法における特定施設です。（下水道法第11条の2）

#### （1）水質汚濁防止法に規定する特定施設

人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。（表1）

#### （2）ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設

ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で具体的に定められています。（表2）

特定施設を有する工場・事業場を特定事業場といい、公共下水道を使用する場合は、次の区分に従って届出が必要です。

届出の種類	届出を要する場合	届出内容	届出の期限
特定施設 設置届出書	公共下水道を使用している者が新たに特定施設を設置する場合	①氏名（法人の場合は代表者名）、名称、住所 ②工場または事業場の名称及び所在地	特定施設の設置工事の60日前まで
特定施設 使用届出書	公共下水道を使用している者で、既設の施設が特定施設に指定された場合	③特定施設の種類 ④特定施設の構造 ⑤特定施設の使用方法 ⑥特定施設から排出される下水の処理方法 ⑦公共下水道に排除される下水の量及び水質その他の国土交通省令で定める事項	特定施設となった日から30日以内
	特定施設を設置している者が新たに公共下水道を使用する場合		公共下水道の使用開始日から30日以内
特定施設の構造等変更届出書	上記の届出のうち④～⑦について内容を変更する場合	①～⑦及び変更内容についてその前後が比較できる資料等	構造等の変更工事の60日前まで
氏名変更等届出書	上記の届出のうち①、②について内容を変更する場合	変更内容等	変更した日から30日以内
特定施設使用廃止届出書	特定施設の使用を全て廃止した場合	使用廃止の年月日等	廃止した日から30日以内
承継届出書	相続や合併などにより届出者の地位を承継した場合	承継の年月日等	承継した日から30日以内

(表1) 特定施設一覧表(水質汚濁防止法に規定する特定施設)

番号	名称
1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの (イ) 選鉱施設 (ロ) 選炭施設 (ハ) 坑水中和沈でん施設 (ニ) 掘削用の泥水分離施設
1-2	畜産農業又はサービス業 (イ) 豚房施設(豚房総面積 50 m <sup>2</sup> 以上) (ロ) 牛房施設(牛房総面積 200 m <sup>2</sup> 以上) (ハ) 馬房施設(馬房総面積 500 m <sup>2</sup> 以上)
2	畜産食料品製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 洗浄施設(洗びん施設を含む) (ハ) 湯煮施設
3	水産食料品製造業 (イ) 水産動物原料処理施設 (ロ) 洗浄施設 (ハ) 脱水施設 (ニ) ろ過施設 (ホ) 湯煮施設
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 洗浄施設 (ハ) 圧搾施設 (ニ) 湯煮施設
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 洗浄施設 (ハ) 湯煮施設 (ニ) 濃縮施設 (ホ) 精製施設 (ハ) ろ過施設
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
7	砂糖製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 洗浄施設(流送施設を含む) (ハ) ろ過施設 (ニ) 分離施設 (ホ) 精製施設
8	パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でん槽
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
10	飲料製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 洗浄施設(洗びん施設を含む) (ハ) 搾汁施設 (ニ) ろ過施設 (ホ) 湯煮施設 (ハ) 蒸留施設
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 洗浄施設 (ハ) 圧搾施設 (ニ) 真空濃縮施設 (ホ) 水洗式脱臭施設
12	動植物油脂製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 洗浄施設 (ハ) 圧搾施設 (ニ) 分離施設
13	イースト製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 洗浄施設 (ハ) 分離施設
14	でん粉又は化工でん粉の製造業 (イ) 原料浸せき施設 (ロ) 洗浄施設(流送施設を含む) (ハ) 分離施設 (ニ) 洗だめ及びこれに類する施設
15	ぶどう糖又は水あめの製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) ろ過施設 (ハ) 精製施設
16	麺類製造業の用に供する湯煮施設
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
18	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
18-2	冷凍調理食品製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 湯煮施設 (ハ) 洗浄施設
18-3	たばこ製造業 (イ) 水洗式脱臭施設 (ロ) 洗浄施設
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業 (イ) まゆ湯煮施設 (ロ) 副蚕処理施設 (ハ) 原料浸せき施設 (ニ) 精練機及び精練そう (ホ) シルケット機 (ハ) 漂白機及び漂白そう (ト) 染色施設 (フ) 薬液浸透施設 (リ) のり抜き施設
20	洗毛業 (イ) 洗毛施設 (ロ) 洗化炭施設
21	化学繊維製造業 (イ) 湿式紡糸施設 (ロ) リンター又は未精練繊維の薬液処理施設 (ハ) 原料回収施設
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
21-4	パーティクルボード製造業 (イ) 湿式バーカー (ロ) 接着機洗浄施設
22	木材薬品処理業 (イ) 湿式バーカー (ロ) 薬液浸透施設
23	パルプ、紙又は紙加工品の製造業 (イ) 原料浸せき施設 (ロ) 湿式バーカー (ハ) 碎木機 (ニ) 蒸解施設 (ホ) 蒸解廃液濃縮施設 (ハ) チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設 (ト) 漂白施設 (チ) 抄紙施設(抄造施設を含む) (リ) セロハン製膜施設 (ヌ) 湿式繊維板成型施設 (ル) 廃ガス洗浄施設
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業 (イ) 自動式フィルム現像洗浄施設 (ロ) 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

番号	名称
24	化学肥料製造業 (イ) ろ過施設 (ロ) 分離施設 (ハ) 水洗式破碎施設 (ニ) 廃ガス洗浄施設 (ホ) 湿式集じん施設
25	水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業 (イ) 塩水精製施設 (ロ) 電解施設
26	無機顔料製造業 (イ) 洗浄施設 (ロ) ろ過施設 (ハ) カドミウム系無機顔料製造業施設のうち遠心分離機 (ニ) 群青製造施設のうち水洗式分別施設 (ホ) 廃ガス洗浄施設
27	25・26以外の無機化学工業製品製造業 (イ) ろ過施設 (ロ) 遠心分離機 (ハ) 硫酸製造施設のうち亜硫酸ガス冷却洗浄施設 (ニ) 活性炭又は二硫化炭素製造施設のうち洗浄施設 (ホ) 無水けい酸製造施設のうち塩酸回収施設 (ハ) 青酸製造施設のうち反応施設 (ト) よう素製造施設のうち吸着施設及び沈でん施設 (フ) 海水マグネシア製造施設のうち沈殿施設 (リ) バリウム化合物製造施設のうち水洗式分別施設 (ヌ) 廃ガス洗浄施設 (ル) 湿式集じん施設
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業 (イ) 湿式アセチレンガス発生施設 (ロ) 酢酸エステル製造施設のうち洗浄施設及び蒸留施設 (ハ) ポリビニルアルコール製造施設のうちメチルアルコール蒸留施設 (ニ) アクリル酸エステル製造施設のうち蒸留施設 (ホ) 塩化ビモノマー洗浄施設 (ハ) クロロブレンマノマー洗浄施設
29	コールタール製品製造業 (イ) ベンゼン類硫酸洗浄施設 (ロ) 静置分離器 (ハ) タール酸ソーダ硫酸分解施設
30	発酵工業 (5・10・13以外) (イ) 原料処理施設 (ロ) 蒸留施設 (ハ) 遠心分離機 (ニ) ろ過施設
31	メタ誘導品製造業 (イ) メチルアルコール又は四塩化炭素の製造の製造施設のうち蒸留施設 (ロ) ホルムアルデヒド製造施設のうち精製施設 (ハ) フロンガス製造施設のうち洗浄施設及びろ過施設
32	有機顔料又は合成洗料の製造業 (イ) ろ過施設 (ロ) 顔料又は染色レーキの製造施設のうち水洗施設 (ハ) 遠心分離機 (ニ) 廃ガス洗浄施設
33	合成樹脂製造業 (イ) 縮合反応施設 (ロ) 水洗施設 (ハ) 遠心分離機 (ニ) 静置分離器 (ホ) 弗素樹脂製造の施設のうちガス冷却洗浄施設及び蒸留施設 (ハ) ポリプロピレン製造施設のうち溶剤蒸留施設 (ト) 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち溶剤回収施設 (フ) ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設 (リ) 廃ガス洗浄施設 (ヌ) 湿式集じん施設
34	合成ゴム製造業 (イ) ろ過施設 (ロ) 脱水施設 (ハ) 水洗施設 (ニ) ラテックス濃縮施設 (ホ) スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち静置分離器
35	有機ゴム薬品製造業 (イ) 蒸留施設 (ロ) 分離施設 (ハ) 廃ガス洗浄施設
36	合成洗剤製造業 (イ) 廃酸分離施設 (ロ) 廃ガス洗浄施設 (ハ) 湿式集じん施設
37	石油化学工業 (31～36以外、石油又は石油副生ガス中の炭化水素の分解、分離、その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業で51に掲げる事業を除く) (イ) 洗浄施設 (ロ) 分離施設 (ハ) ろ過施設 (ニ) アクリロニトリル製造施設のうち急冷施設及び蒸留施設 (ホ) アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち蒸留施設 (ハ) アルキルベンゼン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設 (ト) イソプロピルアルコール製造施設のうち蒸留施設及び硫酸濃縮施設 (フ) エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち蒸留施設及び濃縮施設 (リ) 2-エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち縮合反応施設及び蒸留施設 (ヌ) シクロヘキサノン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設 (ル) トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうちガス冷却洗浄施設 (オ) ノルマルパラフィン製造施設のうち酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸留施設 (リ) プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器 (カ) メチルエチルケトン製造施設のうち水蒸気凝縮施設 (ヨ) メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち反応施設及びメチルアルコール回収施設 (ク) 廃ガス洗浄施設

番号	名称
38	石けん製造業 (イ) 原料精製施設 (ロ) 塩析施設
38-2	界面活性剤製造業の用に供する反応施設 (1. 4-ジオキサンが発生するものに限り洗浄装置を有しないものを除く)
39	硬化油製造業 (イ) 脱酸施設 (ロ) 脱臭施設
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸留施設
41	香料製造業 (イ) 洗浄施設 (ロ) 抽出施設
42	ゼラチン又はにかわの製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 石灰づけ施設 (ハ) 洗浄施設
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
44	天然樹脂製品製造業 (イ) 原料処理施設 (ロ) 脱水施設
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸留施設
46	有機化学工業製品製造業 (28～45 以外) (イ) 水洗施設 (ロ) ろ過施設 (ハ) ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設 (ニ) 廃ガス洗浄施設
47	医薬品製造業 (イ) 動物原料処理施設 (ロ) ろ過施設 (ハ) 分離施設 (ニ) 混合施設 (水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質を有するものを混合するもの、以下同じ) (ホ) 廃ガス洗浄施設
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設
49	農薬製造業の用に供する混合施設
50	水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質を有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
51	石油精製業 (潤滑油再生業を含む) (イ) 脱塩施設 (ロ) 原油常圧蒸留施設 (ハ) 脱留施設 (ニ) 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設 (ホ) 潤滑油洗浄施設
51-2	自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業 (防振ゴム製造業を除く) 更正タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
51-3	医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成型型洗浄施設
52	皮革製造業 (イ) 洗浄施設 (ロ) 石灰づけ施設 (ハ) タンニンづけ施設 (ニ) クロム浴施設 (ホ) 染色施設
53	ガラス又はガラス製品の製造業 (イ) 研磨洗浄施設 (ロ) 廃ガス洗浄施設
54	セメント製品製造業 (イ) 抄造施設 (ロ) 成型機 (ハ) 水養生施設 (蒸気養生施設を含む)
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
58	窒業原料 (うわ薬原料を含む) の精製業 (イ) 水洗式破碎施設 (ロ) 水洗式分別施設 (ハ) 酸処理施設 (ニ) 脱水施設
59	碎石業 (イ) 水洗式破碎施設 (ロ) 水洗式分別施設
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
61	鉄鋼業 (イ) タール及びガス液分離施設 (ロ) ガス冷却洗浄施設 (ハ) 圧延施設 (ニ) 焼入れ施設 (ホ) 湿式集じん施設
62	非鉄金属製造業 (イ) 還元槽 (ロ) 電解施設 (熔融塩電解施設を除く) (ハ) 焼入れ施設 (ニ) 水銀精製施設 (ホ) 廃ガス洗浄施設 (ハ) 湿式集じん施設
63	金属製品製造業又は機械器具製造業 (武器製造業を含む) (イ) 焼入れ施設 (ロ) 電解式洗浄施設 (ハ) カドミウム電極又は鉛電極の化成施設 (ニ) 水銀精製施設 (ホ) 廃ガス洗浄施設
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス施設
64	ガス供給業又はコークス製造業 (イ) タール及びガス液分離施設 (ロ) ガス冷却洗浄施設 (脱硫化水素施設を含む)

番号	名称
64-2	水道施設（水道法（昭和32年法律第177号）第3条第8項に規定するものをいう）工業用水道路施設（工業用水道事業法（昭和33年法律第84号）第2条第6項に規定するものをいう）又は自家用工業用水道（同法第21条第1項に規定するものをいう）の施設のうち、浄水施設であって、次に掲げるもの（これらの浄水能力が1日当たり1万立方メートル未満の事業場に係るものを除く）（イ）沈でん施設（ロ）ろ過施設
65	酸又はアルカリによる表面処理施設
66	電気めっき施設
66-2	エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設（前各号に該当するものを除く）
66-3	旅館業（旅館業法（昭和23年法律第138号）第2条第1項に規定するもので下宿営業を除く）（イ）ちゅう房施設（ロ）洗濯施設（ハ）入浴施設
66-4	共同調理場（学校給食法（昭和29年法律第160号）第5条の2に規定する施設をいう）に設置されるちゅうぼう施設（業務の用に供する部分の総床面積（以下「総床面積」という）が500㎡以上の施設）
66-5	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅうぼう施設（総床面積360㎡以上の施設）
66-6	飲食店（66-7.8に掲げるものを除く）に設置されるちゅうぼう施設（総床面積が420㎡以上の施設）
66-7	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店に設置されるちゅうぼう施設（総床面積630㎡以上の施設）
66-8	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅうぼう施設（総床面積1,500㎡以上の施設）
67	洗たく業の用に供する洗浄施設
68	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設
68-2	病院（医療法（昭和23年法律第205号）第1条第1項に規定するものをいう以下同じ）で病床数が300以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの（イ）ちゅう房施設（ロ）洗浄施設（ハ）入浴施設
69	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
69-2	中央卸売市場（卸売市場法（昭和46年法律第35号）第2条第3項に規定するものをいう）に設置される施設であって、次に掲げるもの（水産物に係るものに限る）（イ）卸売場（ロ）仲卸売場
69-3	地方卸売市場（卸売市場法第2条第4項に規定するもの（卸売市場法施行令（昭和46年政令第221号）第2条第2項に規定するものを除く）に設置される施設であって、次に掲げるもの（水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000㎡未満の事業場を除く）（イ）卸売場（ロ）仲卸売場
70	廃油処理施設（海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和45年法律第136号）第3条第9号に規定するものをいう）
70-2	自動車分解整備事業（道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第77条に規定するものをいう以下同じ）の用に供する洗車施設（屋内作業場の総面積が800㎡未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。）
71	自動式車両洗浄施設
71-2	科学技術に関する研究等を行う事業場（イ）洗浄施設（ロ）焼入れ施設 ※科学技術に関する研究等を行う事業場とは次に掲げるもの1. 国又は地方公共団体の試験研究機関（人文科学のみに係るものを除く）2. 大学及びその附属試験研究機関（人文科学のみに係るものを除く）3. 学術研究（人文科学のみに係るものを除く）、又は製品の製造若しくは技術の改良、考案、若しくは発明に係る試験研究を行う研究所（1・2に該当するものを除く）4. 農業・水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う、高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校・職員訓練施設又は職業訓練施設5. 保健所6. 検疫所7. 動物検疫所8. 植物検疫所9. 家畜保健衛生所10. 検査業に属する事業場11. 商品検査業に属する事業場12. 臨床検査業に属する事業場13. 犯罪鑑識施設

番号	名称
71-3	一般廃棄物処理（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第8条第1項に規定するものをいう）である焼却施設。
71-4	産業廃棄物処理施設（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう）（イ）廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者（同法第14条第4項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第4項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く）をいう）が設置するもの（ロ）廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第12号から第13号までに掲げる施設
71-5	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設（前各号に該当するものを除く）
71-6	トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設（前各号に該当するものを除く）
72	し尿処理施設（建築基準法施行令（昭和25年政令第388号）第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く）
73	下水道終末処理施設
74	特定事業場から排出される水（公共用水域に排出されるものを除く）の処理施設（72.73を除く）

(表2) 特定施設一覧表 (ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設)

番号	名称
1	硫酸塩パルプ (クラフトパルプ) 又は亜硫酸パルプ (サルファイトパルプ) の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂白施設
2	カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設
3	硫酸カリウムの製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
4	アルミナ繊維の製造の用に供する施設のうち、廃ガス洗浄施設
5	担体付き触媒の製造 (塩素又は塩素化合物を使用するものに限る) の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設
6	塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設
7	カプロラクタムの製造 (塩化ニトロシルを使用するものに限る) の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ) 硫酸濃縮施設 (ロ) シクロヘキサン分離施設 (ハ) 廃ガス洗浄施設
8	クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ) 水洗施設 (ロ) 廃ガス洗浄施設
9	4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ) ろ過施設 (ロ) 乾燥施設 (ハ) 廃ガス洗浄施設
10	2・3-ジクロロ-1・4-ナフトキノンの製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ) ろ過施設 (ロ) 廃ガス洗浄施設
11	8・18-ジクロロ-5・15-ジエチル-5・15-ジヒドロジインドロ[3・2-b:3'2'-m]トリフェノジオキサジン (別名ジオキシンバイオレット。ハにおいて単に「ジオキサジンバイオレット」という。) の製造の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ) ニトロ化誘導体分離施設及び還元誘導体分離施設 (ロ) ニトロ化誘導体洗浄施設及び還元誘導体洗浄施設 (ハ) ジオキサジンバイオレット洗浄施設 (ニ) 熱風乾燥施設
12	アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、次に掲げるもの (イ) 廃ガス洗浄施設 (ロ) 湿式集じん施設
13	亜鉛の回収 (製鋼の用に供する電気炉から発生するばいじんであって、集じん機により集められたものからの亜鉛の回収に限る。) の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ) 精製施設 (ロ) 廃ガス洗浄施設 (ハ) 湿式集じん施設
14	担体付き触媒 (使用済みのものに限る。) からの金属の回収 (ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法 (焙焼炉で処理しないものに限る。) によるものを除く。) の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ) ろ過施設 (ロ) 精製施設 (ハ) 廃ガス洗浄施設
15	別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設のうち次に掲げるもの及び当該廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの (イ) 廃ガス洗浄施設 (ロ) 湿式集じん施設
16	廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和46年政令第300号) 第7条第12号の2及び第13号に掲げる施設
17	フロン類 (特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令 (平成6年政令第308号) 別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。) の破壊 (プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法によるものに限る。) の用に供する施設のうち、次に掲げるもの (イ) プラズマ反応施設 (ロ) 廃ガス洗浄施設 (ハ) 湿式集じん施設
18	下水道終末処理施設 (第1号から前号まで及び次号に掲げる施設に係る汚水又は廃液を含む下水を処理するものに限る。)
19	第1号から第17号までに掲げる施設を設置する工場又は事業場から排出される水 (第1号から第17号までに掲げる施設に係る汚水若しくは廃液又は当該汚水若しくは廃液を処理したものを含むもの) に限り、公共用水域に排出されるものを除く。) の処理施設 (前号に掲げるものを除く。)



#### 4. 下水排水基準

対象者／排水量 対象物質又は項目		特定事業場		非特定事業場		
		50 m <sup>3</sup> /日以上	50 m <sup>3</sup> /日未満	50 m <sup>3</sup> /日以上	50 m <sup>3</sup> /日未満	
生活環境項目等	温度	45℃未満	—	45℃未満	—	
	水素イオン濃度	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え9未満	5を超え11未満	
	生物化学的酸素要求量	600	600	600	—	
	浮遊物質	600	600	600	—	
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	5	5	5	20
		動植物油類	60	60	60	—
	窒素消費量	220	—	220	—	
	窒素含有量	—	—	—	—	
	リン含有量	—	—	—	—	
	フェノール類	5	—	5	—	
	銅及びその化合物	3	3	3	3	
	亜鉛及びその化合物	2	2	2	2	
	鉄及びその化合物(溶解性)	10	—	10	—	
	マンガン及びその化合物(溶解性)	10	—	10	—	
	クロム及びその化合物	2	2	2	2	
	健康項目	カドミウム及びその化合物	0.003	0.003	0.003	0.003
シアン化合物		1	1	1	1	
有機リン化合物		1	1	1	1	
鉛及びその化合物		0.1	0.1	0.1	0.1	
六価クロム化合物		0.5	0.5	0.5	0.5	
砒素及びその化合物		0.1	0.1	0.1	0.1	
水銀及びアルキル水銀その他水銀化合物		0.005	0.005	0.005	0.005	
アルキル水銀化合物		検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル		0.003	0.003	0.003	0.003	
トリクロロエチレン		0.1	0.1	0.1	0.1	
テトラクロロエチレン		0.1	0.1	0.1	0.1	
ジクロロメタン		0.2	0.2	0.2	0.2	
四塩化炭素		0.02	0.02	0.02	0.02	
1・2-ジクロロエタン		0.04	0.04	0.04	0.04	
1・1-ジクロロエチレン		1	1	1	1	
シス-1・2-ジクロロエチレン		0.4	0.4	0.4	0.4	
1・1・1-トリクロロエタン		3	3	3	3	
1・1・2-トリクロロエタン		0.06	0.06	0.06	0.06	
1・3-ジクロロプロペン		0.02	0.02	0.02	0.02	
チウラム		0.06	0.06	0.06	0.06	
シマジン		0.03	0.03	0.03	0.03	
チオベンカルブ		0.2	0.2	0.2	0.2	
ベンゼン		0.1	0.1	0.1	0.1	
セレン及びその化合物		0.1	0.1	0.1	0.1	
ほう素及びその化合物		10	10	10	10	
ふっ素及びその化合物		8	8	8	8	
1・4-ジオキサン		0.5	0.5	0.5	0.5	
ダイオキシン類		10	10	10	10	
アンモニア性窒素等含有量		—	—	—	—	

(注) 単位は、水素イオン濃度は無単位、ダイオキシン類は pg/ℓ その他はすべて mg/ℓ で示す。